Спектры остаточной фотопроводимости в гетероструктурах InAs/AISb с квантовыми ямами

© В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко[¶], Д.М. Гапонова, А.В. Иконников, К.В. Маремьянин, С.В. Морозов, Ю.Г. Садофьев^{*}, S.R. Johnson^{*}, Y.-H. Zhang^{*}

Институт физики микроструктур Российской академии наук,

603950 Нижний Новгород, Россия

* Department of Electrical Engineering and Center for Solid State Electronic Research, Arizona State University, Tempe, AZ 85287, USA

(Получена 1 июня 2004 г. Принята к печати 14 июня 2004 г.)

Исследовалась остаточная фотопроводимость гетероструктур AlSb/InAs/AlSb с двумерным электронным газом в квантовых ямах InAs при T = 4.2 К. При подсветке ИК излучением $\hbar\omega = 0.6-1.2$ эВ наблюдалась положительная остаточная фотопроводимость, связываемая с фотоионизацией глубоких доноров. В коротковолновой области наблюдается отрицательная остаточная фотопроводимость, связанная с межзонной генерацией электронно–дырочных пар с последующим разделением электронов и дырок встроенным электронов, захватом электронов на ионизованные доноры и рекомбинацией дырок с двумерными электронами в InAs. При $\hbar\omega > 3.1$ эВ обнаружено резкое падение отрицательной фотопроводимости, связываемое с включением нового канала фотоионизации глубоких доноров в AlSb за счет переходов электронов в вышележащую над зоной проводимости энергетическую зону.

1. Введение

Квантово-размерные гетероструктуры на основе InAs представляют интерес для создания высокочастотных транзисторов, резонансно-туннельных диодов, оптоэлектроники среднего инфракрасного диапазона и спинтроники. Большое число выполненных исследований было посвящено гетеросистеме InAs/AlSb, которая характеризуется большой величиной разрыва зоны проводимости на гетерогранице, составляющей 1.35 эВ, высокой подвижностью электронов в квантовой яме (КЯ) InAs, достигающей $9 \cdot 10^5 \, \text{см}^2 / \text{B} \cdot \text{с}$ при $T = 4.2 \, \text{K}$, $n_s \approx 10^{12} \, {\rm сm}^{-2}$ [1], которые присутствуют даже в номинально не легированных структурах [2]. "Поставщиками" электронов в КЯ InAs могут быть глубокие доноры в AlSb и поверхностные доноры в покрывающем слое GaSb [3-10]. Одной из специфических особенностей рассматриваемой гетеросистемы является биполярность остаточной фотопроводимости при низких температурах [2]. При освещении гетероструктур ИК излучением наблюдается положительная остаточная фотопроводимость (Positive Persistent Photoconductivity — РРРС) [11,12], которая связывается с фотовозбуждением глубоких донорных центров в барьерных слоях AlSb. Фотовозбужденные электроны захватываются квантовой ямой InAs, увеличивая тем самым концентрацию двумерных (2D) электронов, которая остается неизменной в течение многих часов вплоть до отогрева образца. При освещении гетероструктур видимым излучением наблюдается отрицательная остаточная фотопроводимость (Negative Persistent Photoconductivity — NPPC) [2,10–12], которая связывается с межзонной генерацией электронно-дырочных пар, разделением электронов и дырок встроенным электрическим полем с последующими захватом электронов ионизованными донорами и рекомбинацией дырок с 2D электронами в InAs.

До настоящего времени спектры остаточной фотопроводимости в гетероструктурах InAs / AlSb исследовались лишь в работе [11] для нелегированных образцов в диапазоне энергий квантов $\hbar\omega = 1-3$ эВ. Настоящая работа посвящена спектральным исследованиям остаточной фотопроводимости как в нелегированных, так и в селективно легированных гетероструктурах InAs / AlSb в более широком интервале энергий квантов 0.6–6 эВ с целью обнаружения новых спектральных особенностей, которые могли бы пролить свет на происхождение двумерного электронного газа в номинально не легированных структурах.

2. Эксперимент

Исследуемые гетероструктуры были выращены методом эпитаксии из молекулярных пучков [1,13]. На полуизолирующей подложке GaAs (100) выращивался композитный буфер, включающий в себя метаморфный слой AlSb или GaSb толщиной 2.4 мкм и 10 периодов сверхрешетки GaSb (2.5 нм) / AlSb (2.5 нм). Активная часть состояла из нижнего барьера AlSb толщиной 12-40 нм, КЯ InAs шириной 15 нм, верхнего барьера AlSb или Al_{0.8}Ga_{0.2}Sb толщиной 30-40 нм и защитного слоя GaSb толщиной 6 нм. Селективно легированные структуры содержали два б-слоя теллура, расположенных в барьерах AlSb на расстоянии 15 нм от КЯ. Последовательность работы заслонок обеспечивала формирование химических связей типа In-Sb на обеих границах раздела квантовой ямы [14]. Концентрация и подвижность 2D электронов определялись при $T = 4.2 \, \mathrm{K}$ из измерений эффекта Холла и осцилляций Шубниковаде-Гааза. Параметры образцов представлены в таблице.

Спектры остаточной фотопроводимости исследовались с помощью решеточного монохроматора МДР-23 (рис. 1). Использовались кварцевая лампа накаливания в

[¶] E-mail: gavr@ipm.sci-nnov.ru

Образец	Буфер	Верхний барьер	$n_s, 10^{12} \mathrm{cm}^{-2}$	μ , 10 ⁵ cm ² /B · c
A856	AlSb	Al _{0.8} Ga _{0.2} Sb	0.65	3.9
A839	AlSb	AlSb	0.68	2.5
B824	GaSb	AlSb	0.95	4.4
B1445	AlSb	AlSb	2.4	1.0
B1444	AlSb	AlSb	3.2	0.63

Параметры исследованных образцов при $T = 4.2 \,\mathrm{K}$

качестве источника излучения и стандартные светофильтры для отсечки высших порядков дифракции излучения. С выхода монохроматора излучение с энергией квантов в диапазоне 0.6-4 эВ (до 6 эВ при исследовании образца В824) по волоконному световоду подводилось к образцу, расположенному в транспортном гелиевом сосуде Дьюара. Образец имел форму прямоугольной пластинки с характерными размерами 4 × 4 мм, по краям которой (на расстоянии около 3 мм) были нанесены два полосковых индиевых контакта. Измерения спектров фотопроводимости проводились в двух режимах: по точкам после выключения подсветки, начиная с длинноволновой части спектра, и при непрерывном освещении монохроматическим излучением и медленной развертке длины волны, начиная с коротковолновой части спектра. Характерное время записи спектра составляло несколько десятков минут.

3. Результаты и обсуждение

На рис. 2 представлены спектры фотопроводимости в номинально не легированных гетероструктурах А839, А856, В824. Видно, что для этих образцов полученные с помощью двух различных методов измерения спектры фотопроводимости (точки с сплошные кривые) хорошо соответствуют друг другу. Это свидетельствует о том, что в данных образцах в обоих случаях измерялась остаточная фотопроводимость, т.е. эффект постоянной подсветки при непрерывной записи спектральных зависимостей невелик. Для сравнения на рис. 2 представлен также спектр фотопроводимости для подобного образца AlSb/InAs/AlSb с шириной квантовой ямы InAs 12 нм из работы [11]. Так же, как и в работе [11], в длинноволновой области спектра наблюдается РРРС, начиная с наименьшей из используемых нами энергий квантов $\hbar \omega = 0.62$ эВ. При $\hbar \omega > 1.1$ эВ наблюдается увеличение сопротивлений образцов и РРРС сменяется на NPPC с одновременным нарастанием крутизны спектральных зависимостей. Во всех трех образцах при $\hbar \omega > 2.1$ эВ наблюдаются несколько характерных локальных максимумов NPPC, а при $\hbar \omega > 3.1 \, \text{эB}$ — резкое падение сопротивления. Для образца В824 измерения были проведены вплоть до $\hbar\omega = 6 \, \mathrm{sB}$; начиная с 5 sB наблюдалось незначительное плавное возрастание величины NPPC. В работе [11] измерения проводились до энергии квантов 3 эВ, и эффект падения сопротивления в ультрафиолетовой области спектра не был обнаружен.

Отметим, что состав толстого метаморфного буфера — GaSb (B824) или AlSb (A839) — практически не влияет на вид спектров фотопроводимости. Использование же твердого раствора Al_{0.8}Ga_{0.2}Sb (A856) в качестве верхнего барьера приводит к смещению участка с



Рис. 1. Блок-схема установки для измерения остаточной фотопроводимости при освещении образца светом с различной длиной волны. *1* — поворотное зеркало, *2* — кварцевая лампа накаливания, *3* — сферическое зеркало, *4* — дифракционная решетка, *5* — световод, *6* — сверхпроводящий соленоид, *7* — исследуемый образец.



Рис. 2. Спектры фотопроводимости номинально не легированных гетероструктур InAs/AlSb (кривые 1–3). Сплошные кривые получены при постоянно включенной подсветке и непрерывной развертке длины волны излучения (от больших энергий квантов к меньшим), точки соответствуют остаточным (после выключения подсветки) значениям сопротивления, полученным при последовательном увеличении энергии квантов подсветки. Горизонтальными точечными линиями показаны темновые (после охлаждения до первого включения подсветки) значения сопротивления, подсветки) значения сопротивлений образцов. Образцы: 1 — А839, 2 — В824, 3 — А856. 4 — спектр фотопроводимости для образца В из работы [11] (в произвольных единицах).



Рис. 3. Зонная структура номинально не легированных образцов InAs/AlSb (схема). 2D электронный газ в квантовой яме InAs возникает вследствие ионизации доноров на поверхности покрывающего слоя GaSb и глубоких доноров в барьерах AlSb, что приводит к возникновению встроенного электрического поля. Пунктирной линией показано положение Г-долины в зоне проводимости AlSb. Стрелками показаны энергии (эВ).

высокой крутизной изменения сопротивления в сторону меньших энергий квантов. При этом большая часть наблюдаемых спектральных особенностей (в частности, локальный пик сопротивления при $\hbar\omega \approx 2.2$ эВ и резкое уменьшение величины сопротивления при $\hbar\omega > 3.1$ эВ) не меняют своего положения.

На рис. 3 схематически изображена зонная диаграмма активной части номинально не легированной гетероструктуры с 2D электронным газом в квантовой яме InAs. Вслед за авторами работы [11] мы связываем наблюдаемую в длинноволновой области РРРС с фотоионизацией глубоких доноров и накоплением электронов в квантовой яме. Природа глубоких доноров требует дополнительного исследования. РРРС имеет место при энергиях ($\hbar \omega \ge 0.62$ эВ), меньших, чем расстояние от уровня Ферми (который расположен на расстоянии порядка 100 мэВ от дна зоны проводимости InAs) до края зоны проводимости в AlSb. Такие переходы могут осуществляться с нейтральных (т.е. лежащих под уровнем Ферми) доноров в объеме барьерных слоев AlSb на высшие подзоны размерного квантования электронов в квантовой яме InAs, волновая функция которых, как известно, гораздо дальше проникает в барьер, чем волновая функция нижней подзоны размерного квантования. Возбужденные в яму электроны быстро релаксируют на состояния первой подзоны, откуда их обратный переход на ионизированные донорные центры затруднен по вышеуказанной причине.

Как и авторы работы [11], мы полагаем, что наблюдаемая при увеличении энергии квантов NPPC связана с межзонной генерацией электронно-дырочных пар с последующим разделением носителей встроенным электрическим полем, увлечением дырок к квантовой яме и их рекомбинацией с 2D электронами. Первоначально электронно-дырочные пары генерируются в покрывающем слое GaSb. Пороговая энергия для NPPC должна превышать сумму ширины непрямой запрещенной зоны GaSb $\varepsilon_L \approx 0.82$ эВ [15] и разрыва валентной зоны на границе раздела покрывающего слоя с верхним барьером (0.35 эВ для AlSb, см. рис. 3). Новый канал инжекции дырок в барьер включается, когда энергия генерируемых при прямых межзонных оптических переходах в GaSb легких дырок превышает величину разрыва валентной зоны на гетерогранице GaSb/AlSb. Это соответствует энергии квантов, равной примерно сумме прямой запрещенной зоны $\varepsilon_{\Gamma} \approx 0.81 \text{ эB}$, и удвоенной величине разрыва валентной зоны (вследствие близости эффективных масс электронов в Г-долине и легких дырок), что равно ~ 1.5 эВ. При дальнейшем росте энергии квантов начинается генерация электроннодырочных пар через непрямую запрещенную зону AlSb (при $\hbar \omega > \varepsilon_X = 1.61$ эВ, см. рис. 3), и, наконец, при $\hbar\omega = 2.39$ эВ должны включаться прямые оптические переходы электронов из валентной зоны в Г-долину зоны проводимости AlSb. Наличие более узкозонного верхнего барьера Al_{0.8}Ga_{0.2}Sb должно приводить к уменьшению всех пороговых энергий для NPPC, что и имеет место для образца А856 (см. рис. 2).

В интервале энергий квантов 1.4-2.1 эВ для всех трех исследованных образцов наблюдались осцилляции спектральных зависимостей сопротивления (рис. 4). В образцах А839 и В824 с одинаковыми барьерами AlSb совпадают как периоды, так и фазы осцилляций. Для этих структур период составляет около 50 мэВ в длинноволновой и 40 мэВ в коротковолновой областях. Для образца А856 с более узкозонным верхним барьером Al_{0.8}Ga_{0.2}Sb период осцилляций изменяется соответственно от 48 до 35 мэВ. Подобная осцилляторная зависимость наблюдалась для одного из образцов в работе [11], однако там период осцилляций изменялся от 80 мэВ в длинноволновой области до 50 мэВ в коротковолновой. В работе [11] было высказано предположение, что осцилляции связаны с испусканием продольных оптических фононов $\hbar\omega_{LO}$ легкими дырками, возбужденными при прямых оптических переходах в GaSb и инжектированными в AlSb. В этом случае период осцилляций должен составлять примерно удвоенную (вследствие близости эффективных масс электронов и легких дырок) энергию оптического фонона в AlSb, т.е. около 80 мэВ, что соответствует наблюдавшемуся в [11] периоду осцилляций для длинноволновой области. Уменьшение периода осцилляций до 50 мэВ в коротковолновой области в этом случае естественно связать с ростом эффективной массы электрона из-за непараболичности закона дисперсии. Однако в настоящей работе наблюдались заметно меньшие периоды осцилляций, что указывает на их иную природу. Возможно, они связаны с межзонным возбуждением электронов в высшие подзоны в квантовой яме InAs, с последующим захватом их на ионизированные глубокие донорные центры в барьерных слоях.

Следует подчеркнуть, что порог резкого возрастания NPPC для всех исследованных нами структур приходится на энергии квантов излучения, заметно меньшие ширины запрещенной зоны в Г-точке барьерных слоев $(\varepsilon_{\Gamma} = 2.39 \text{ эВ в AlSb [15]}, \varepsilon_{\Gamma} = 2.06 \text{ эВ для Al}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Sb}$ на буфере AlSb — по нашим оценкам с учетом упругой деформации) (рис. 2). Это позволяет предположить, что данный порог связан с возбуждением электронов из валентной зоны в сравнительно неглубокие донорные состояния под Г-долиной в AlSb, откуда они быстро сваливаются в нижележащую Х-долину, дрейфуют в электрическом поле от квантовой ямы и захватываются на глубокие донорные центры, в то время как дырки дрейфуют к квантовой яме и рекомбинируют с 2D электронами. Характерный максимум NPPC при $\hbar\omega = 2.2\,\mathrm{sB}$ связан скорее всего с присутствием в исследованных гетероструктурах специфических донорных центров, которые, очевидно, отсутствовали в образцах, исследовавшихся в работе [11]. Этот максимум наблюдался как в структурах с верхним барьером AlSb (образцы A839, B824), так и Al_{0.8}Ga_{0.2}Sb (образец A856). Очевидно, в последнем случае он связан с такими же оптическими переходами в нижнем барьере AlSb.

Резкое падение NPPC при $\hbar \omega > 3.1$ эВ свидетельствует о включении нового механизма генерации электронов. Важно подчеркнуть, что, несмотря на большие энергии квантов, этот эффект не может быть связан с включением нового канала межзонных электроннно-дырочных переходов, так как с межзонными переходами (а именно с генерацией дырок и последующей рекомбинацией их с 2D электронами) мы связываем сам эффект NPPC. По нашему мнению, в данном случае наблюдается включение нового канала фотоионизации нейтральных (т.е. находящихся под энергией Ферми) глубоких донорных центров, связанного с возбуждением электронов в вышележащую над зоной проводимости энергетическую зону. По данным измерений электроотражения [16] энергетический зазор между зоной проводимости и вышележащей зоной в Г-точке в AlSb составляет $\Delta_{\Gamma7-\Gamma6} = 1.5$ эВ. Теоретические расчеты [17] предсказывают, что минимуму энергии в вышележащей зоне соответствует боковая долина, расположенная в направлении [100], дно которой находится на 0.5 эВ ниже энергии в Г-точке. Принимая во внимание, что в исследованных структурах уровень Ферми смещен примерно на 0.3 эВ от потолка валентной зоны AlSb, пороговая энергия для переходов с донорных состояний под уровнем Ферми может быть оценена как 3.1 эВ, что хорошо совпадает с энергией квантов, при которых начинается резкий спад NPPC. Отметим, что для образца A856 с верхним барьером Al_{0.8}Ga_{0.2}Sb рост NPPC прекращается при $\hbar \omega = 2.75$ эВ, что может быть истолковано как включение процесса фотоионизации нейтральных глубоких доноров с переходом в вышележащую над зоной проводимости энергетическую зону в верхнем барьере. В структуре с асимметричными барьерами этот процесс генерации электронов конкурирует в определенном интервале энергий квантов с



Рис. 4. Участки спектров фотопроводимости номинально не легированных гетероструктур InAs/AlSb (рис. 2). Образцы: *1* — A839, *2* — B824, *3* — A856. *4* соответствует спектру фотопроводимости образца В из работы [11].



Рис. 5. Спектры фотопроводимости селективно легированных гетероструктур InAs/AlSb. Сплошные кривые получены при постоянно включенной подсветке и непрерывной развертке длины волны излучения (от больших энергий квантов к меньшим), точки соответствуют остаточным (после выключения подсветки) значениям сопротивления, полученным при последовательном увеличении энергии квантов подсветки. Горизонтальными точечными линиями показаны темновые (после охлаждения до первого включения подсветки) значения сопротивления значения сопротивления при значения сопротивления подсветки) значения сопротивления подсветки. Горизонтальными точечными линиями показаны темновые (после охлаждения до первого включения подсветки) значения сопротивлений образцов. Образцы: *1* — B1445, *2* — B1444.

продолжающейся генерацией электронно–дырочных пар в нижнем барьере, что приводит к наблюдаемому при $\hbar\omega = 2.75 - 3.15$ эВ плавному уменьшению NPPC (см. кривую 3 на рис. 2). При $\hbar\omega = 3.15$ эВ включается вышеописанный процесс ионизации нейтральных глубоких доноров в нижнем барьере AlSb, что приводит к излому спектральной зависимости и резкому падению NPPC.

В заключение кратко обсудим особенности спектров фотопроводимости селективно легированных теллуром образцов В1444 и В1445 (рис. 5). В отличие от номинально не легированных структур в данных образцах наблюдается выраженный максимум положительной фотопроводимости в области 1 эВ. Для структуры В1445 с меньшим уровнем легирования в области высоких энергий квантов сохраняется полоса отрицательной фотопроводимости. Для этого образца налицо значительное расхождение результатов, полученных при "поточечных" измерениях спектра остаточной фотопроводимости и непрерывной развертке частоты излучения (точки и сплошная кривая 1 на рис. 5). Для этого образца после выключения подсветки наблюдалась сравнительно быстрая (в течение нескольких десятков секунд) релаксация отрицательной фотопроводимости к меньшему стационарному значению. В образце В1444 с более высоким уровнем легирования также наблюдается характерное возрастание сопротивления в коротковолновой части спектра. Однако его недостаточно, чтобы преодолеть общую (имеющую место для всех частот излучения) тенденцию к падению сопротивления при подсветке образца.

Как видно из сопоставления спектров на рис. 2 и 5, в селективно-легированных структурах сохраняются все особенности фотопроводимости, присущие номинально не легированным образцам. Однако в легированных образцах относительный вклад процессов фотоионизации глубоких уровней, приводящих к РРРС, значительно выше. Видимо, кроме мелких донорных состояний [18], легирующая примесь Те может создавать в AlSb глубокие донорные уровни, состояния которых лежат ниже уровня Ферми. Вероятно, с ионизацией таких уровней связан максимум РРРС при $\hbar\omega = 1$ эВ (рис. 5). При высокой концентрации теллура (образец B1444) процессы фотоионизации глубоких уровней доминируют, и NPPC не наблюдается во всем спектральном диапазоне.

Список литературы

- C. Nguyen, B. Brar, C.R. Bolognesi, J.J. Pekarik, H. Kroemer, J.H. English. J. Electron. Mater., 22, 255 (1993).
- [2] G. Tuttle, H. Kroemer, J.H. English. J. Appl. Phys., **65**, 5239 (1989).
- [3] C. Nguyen, B. Brar, H. Kroemer, J.H. English. Appl. Phys. Lett., 60, 1854 (1992).
- [4] S. Ideshita, A. Furukawa, Y. Mochizuki, M. Mizuta. Appl. Phys. Lett., 60, 2549 (1992).
- [5] J.D. Dow, J. Shen, S.Y. Ren. Superlat. Microstruct., 13, 405 (1993).
- [6] D.J. Chadi. Phys. Rev. B, 47, 13478 (1993).
- [7] J. Shen, J.D. Dow, S.Yu. Ren, S. Tehrani, H. Goronkin. J. Appl. Phys., 73, 8313 (1993).
- [8] J. Shen, H. Goronkin, J.D. Dow, S.Y. Ren. J. Appl. Phys., 77, 1576 (1995).
- [9] A. Furukawa, S. Ideshita. J. Appl. Phys., 75, 5012 (1994).
- [10] I. Lo, W.C. Mitchell, M.O. Manasreh, C.E. Stutx, K.R. Evans. Appl. Phys. Lett., 60, 751 (1992).

- [11] Ch. Gauer, J. Scriba, A. Wixforth, J.P. Kotthaus, C. Nguyen, G. Tuttle, J.H. English, H. Kroemer. Semicond. Sci. Technol., 8, S137 (1993).
- [12] C. Gauer, J. Scriba, A. Wixforth, J.P. Kotthaus, C.R. Bolognesi, C. Nguyen, B. Brar, H. Kroemer. Semicond. Sci. Technol., 9, 1580 (1994).
- [13] Yu.G. Sadofyev, A. Ramamoorthy, B. Naser, J.P. Bird, S.R. Jonson, Y.-H. Zhang. Appl. Phys. Lett., 81, 1833 (2002).
- [14] G. Tuttle, H. Kroemer, J.H. English. J. Appl. Phys., 67, 3032 (1990).
- [15] I. Vufgaftman, J.R. Meyer, L.R. Ram-Mohan. J. Appl. Phys., 89, 5815 (2001).
- [16] M. Cardona, F.H. Pollak, K.L. Shaklee. Phys. Rev. Lett., 16, 644 (1966).
- [17] M.L. Cohen, T.K. Bergstresser. Phys. Rev., 141, 789 (1966).
- [18] A. Nakagawa, J.J. Pekarik, H. Kroemer, J.H. English. Appl. Phys. Lett., 57, 1551 (1990).

Редактор Л.В. Беляков

Persistent photoconductivity spectra in InAs/AISb quantum well heterostructures

V.Ya. Aleshkin, V.I. Gavrilenko, D.M. Gaponova, A.V. Ikonnikov, K.V. Marem'yanin, S.V. Morozov, Yu.G. Sadofyev*, S.R. Johnson*, Y.-H. Zhang*

Institute for Physics of Microstructures of Russian Academy of Sciences, 603950 Nizhny Novgorod, Russia * Department of Electrical Engineering and Center for Solid State Electronic Research, Arizona State University, Tempe, AZ 85287, USA

Abstract The persistent photoconductivity in AlSb/InAs/AlSb heterostructures with two-dimensional electron gas in InAs quantum wells has been investigated at T = 4.2 K. At the excitation by IR radiation $\hbar\omega = 0.6-1.2$ eV positive persistent conductivity has been observed, the effect being related to the photoionization of deep donors. At shorter wavelengths a negative persistent photoconductivity is observed resulting from the band-gap excitation of electron-hole pairs and subsequent separation of electron and holes by the built-in electric field, the electron capture by ionized donors and the hole recombination with two-dimensional electrons in InAs. At $\hbar\omega > 3.1$ eV the abrupt drop of negative photoconductivity has been discovered. This effect is attributed to the switching-on a new channel of photoionization of deep donors in AlSb due to electron transitions into the energy band above the conduction one.